シンクロトロンの周回ビームを拡散させるための断続的

スペクトルを用いた高周波源に関する検討

1. はじめに

重粒子線がん治療は炭素線を使用し、がんだ けを強い力で破壊する。また、体の中をまっす ぐ進み目的地で止まるので、がん患部周辺の正 常細胞への影響が少ないのが利点である[1]。 粒子線の効果的な照射法としてスポットスキ ャニング照射法があり、患部を数千ブロックに 分け細かく照射する方法である。この照射法を 行うためのシンクロトロンからのビーム取り 出し法として QAR 法を提案している[2]。QAR 法の概略は次の通り:1)高速四極電磁石(FQ)

を ON させ、セパラトリクスという安定領域を 収縮させる、2) セパラトリクスからはみ出した 粒子を取出す、3)FQ を OFF する、4) RFK0(RF-knockout)を ON させ、セパラトリクス 境界付近の粒子を拡散、5)上記の流れを繰り返 し行う。

本研究は、RFKOの効果的な周波数スペク トルとその発生システムに関するものである。 本報告ではシミュレーションにより周波数ス ペクトルの最適化を行い、それに必要な発生源 についての検討を述べる。

2. QAR法

QAR 法はビーム加速の後、次のように行う: (1)シンクロトロンの主パラメータを従来の 1/3 共鳴出射法の初期状態の値に設定する、(2) 使用者側からのスタート信号によって FQ が励 磁され、セパラトリクスが収縮を始め、収縮に よって出た粒子が取出される、(3)必要な粒子 数が取り出されると使用者側から FQ のストッ プ信号が送られ、FQ 磁場はゼロに戻され、セ

日大生産工(院) 〇田代 雅嗣

日大生産工 中西 哲也

パラトリクスが元の大きさに広がり、ビーム取 出しは停止する、(4) その後、RFK0 を ON させ ることで、セパラトリクス境界付近まで周回ビ ームが拡散され、ビーム取出しによってできた 空白を埋める。このように FQ と RFK0 を交互に 運転することにより、少しずつビームを取り出 す事ができる。

以上から QAR 法は次のような特徴を持つ: (1)必要なタイミングで必要な量だけビームを 取り出す事ができる、(2)取り出し中のビーム 強度は、スピルフィードバック制御によって一 様になることが期待できる、(3)待機時にシン クロトロンの主電磁石電源のリプルなどによ るビーム出射を抑制できる。(2)(3)の特徴は主 電磁石電源のリプルの許容値を緩和できるた めコストが低減できる。

RFK0 の周波数帯域と出射ビーム強度の一 様性

シンクロトロンは偏向電磁石と四極電磁石 が周期的に配置されており、粒子は中心軌道の 周りをベータートロン振動しながら周回して いる。従って、その振動数に応じた高周波電界 をビーム進行方向と垂直な方向に加えること で振幅を増大させることができ、ビームを取り 出すことができる。しかし、その振動数は振幅 により異なるため、単一の周波数では粒子全て を拡散できない。そこで、周波数に幅を持たせ たカラードノイズ(CN)を使用する。粒子の振 動数は、普及型治療装置のシンクロトロンの場 合1.666…~1.68(周回周波数で規格化した値)。 しかし、この範囲だけでは出射ビーム強度は一

Study on an RF source using a Spectrum Including Many Bands to diffuse a circulating beam in a synchrotron

Masatsugu TASHIRO, Tetsuya NAKANISHI

様にならないことが分かっており、周波数帯は 広いほうが一様性はよくなる。図1はFQを使 わず RFKOを連続運転して取出した結果に対し て、ビーム強度の変化を標準偏差(σ/平均値) で表した。計算は 0.1~f までの各規格化周波 数帯に対して行った。f=4付近から変化が小 さくなっていることから、f=5付近までは必

要と考えた。しか し、アンプの負担 が大きくなる問題 があり、アンプの 負担を軽減する方図1.各周波数帯に対する 法を考えた。 標準偏差

断続的スペクトルによるシミュレーション

様々な周波数帯で計算した結果、n+1/3、 n+2/3付近の周波数帯だけ拡散に寄与すること が分かった。ここで n=0,1,2…である。そこ で、図2に示すような断続的スペクトルを使用 した。従来の連続的スペクトルでは指定した周 波数帯で一様な電圧としたが、断続的スペクト ルを使用することで拡散に寄与しない周波数 帯を除くことができアンプへの負担を小さく できる。計算した結果、0.1~4.7 までの連続 的スペクトルで計算した結果とほぼ同様の一 様性が得られた。このスペクトルによりアンプ の負担を約 90%軽減できる。また、このよう なスペクトルにすることでセパラトリクス内 の任意の領域に存在する粒子群に力を与える ことができる。低域周波数の値を大きくするこ とで、セパラトリクスの境界内部の粒子を拡散 できる。その結果、境界付近の粒子密度は高く なる。図3は周波数帯を変化させた時の取り出 された粒子強度分布である。ベータートロン振 動をカバーする周波数帯(0.65~0.7)の時に比 べ、約10倍取り出された。





5. 周波数帯及び CN 強度の最適化

5.1 条件

断続的スペクトルを用いて各パラメータの 最適化を行った。周波数帯は低域遮断周波数 (fl)をn+0.672から0.001ずつn+0.678まで 大きくして行う。その際、高域遮断周波数(fh) はn+0.680に固定した。1/3 共鳴付近も同様。 図4にスピル波形の一例とFQ,RFK0の振幅波形 を示す。はじめにRFK0を2000ターン運転し、 次にFQを2000ターン直線的に立ち上げ、500 ターン直線的に立ち下げる。1周期4500ター ンを繰り返す。本シミュレーションでは全回転 数20万ターン、セパラトリクスの収縮率は 20%、15%で行った。また全粒子数20万個と した。最適化の条件は以下の2つである。

- 出射粒子数が全粒子数の1.0%以上(出射率)
- 2 誤出射粒子数が出射粒子数の 0.1%以下 (誤出射率)

出射率は FQ 部で取出される割合となり、誤出 射率は RFKO 部+余裕部で取出された割合とな る。余裕部というのは粒子の存在領域とセパラ トリクス境界の空白部を示し、四極電源のふら つきによるセパラトリクスの変動分に相当す る。

5.2 計算結果

図 5 はシミュレーションによるスピル分布 である。出射率、誤出射率を調べる回転数は5 万~20 万ターンとした。5 万ターン以前はスピ ル量が安定せず、5 万ターンまでスピル量が増 え続けているため計算には含まなかった。セパ ラトリクスの収縮率 15%の時の fl に対する出 射率[%]を図 6 に示す。この図から最も出射率 が高い周波数帯は 0.676~0.680 であることが 分かる。表 1 に収縮率 15%、20%での最適化 条件を満たす時と出射率 1.0%を超えた時の CN 強度、fl を記載した。最大出射率で比べる と収縮率 20%の方が 13%多く取出されるが、 CN 強度は 16%増えている。また、出射率 1.0% を超えた時の値を比べると収縮率 15%のほう が CN 強度は 9%増えた。しかし、その程度の 差なら収縮率が小さいほうが良いと考え、周波 数帯は n+0.675~n+0.680 なので収縮率 15%で の最適 fl は n+0.675 であると考えた。



図 4. スピル波形と シミュレーションの流れ



図 5. 回転数に対するスピル量



図 6. 各低域遮断周波数に 対する出射率のグラフ(15%)

表 1. 各収縮率におけるパラメータ

収縮率 [%]	出射率 [%]	CN 強度	fl		
15	1.65	4.5E-05	0.676		
15	1.07	2.4E-05	0.675		
20	1.87	5.2E-05	0.676		
20	1.06	2.2E-05	0.675		

6. マルチバンド RFKO システム

断続的スペクトルを用いた RFKO システムの ブロック図を図7に示す。従来はホワイトノイ ズ(WN)を Amp に通し、IT/APN を通してキッカ 一電極に送るシステムであった。本システムは WN を必要な周波数帯を有する複数の BPF に入 力し、それぞれの出力を加算器で合わせ、Amp に通す方法である。図中には低域側3つの周波 数バンドの例を示している。本報告ではシミュ レーションで用いた 10 個のバンドに対する BPF について Mathematica を用いて計算を行っ た。



図 7.RFKO システム

7. BPF の回路設計

7.1 設計·原理

図8はBPFの回路図である。この回路は2次 正帰還型LPF、HPFを直列接続したものである。 この回路を使用する利点を以下に示す。

- OP アンプ使用の RC フィルタのため、値の 小さい L を使用しなくてもよい
- ② 素子数は多いがCを任意の値にできる
- ③ Rの値は精度よく設定されなければならないが、可変抵抗が容易に入手でき、固定抵抗との組み合わせで達成できると考える回路として使用した LPF、HPF の伝達関数

回路として使用した LPF、HPF の伝達菌家 H_(jw)を以下に示す。

LPF:
$$H_{(j\omega)} = \frac{k \times (j\omega)^2}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{Q}\right)b_1(j\omega) + (b_1)^2}$$

HPF:
$$H_{(j\omega)} = \frac{k \times (b_2)^2}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{o}\right) b_2(j\omega) + (b_2)^2}$$

各式中の Q は任意の値として決めることがで きる。また R_f 、b、k は以下のように求め、代 入し、それぞれの伝達関数を計算する。この時 $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$ 、 $C_1 = C_2 = C_f$ とした。

$$R_{f} = \frac{1}{2\pi f C_{f}}$$
, $b = \frac{1}{R_{f}C_{f}}$, $R_{4} = R_{f}\left(2 - \frac{1}{Q}\right)$, $k = 1 + \frac{R_{4}}{R_{f}}$

*R_f*を求める際に使用する f は各フィルタの 遮断周波数である。LPF と HPF で使用する遮断 周波数は違うので、それぞれの値を代入し計算 を行う。この回路を使用し帯域幅が 17[kHz]と 狭帯域で、その間がフラットになる伝達特性を 得る。



7.2 回路定数の計算結果

Mathematicaによる計算結果の一例として 入出力特性を図9に示す。横軸は周波数、縦軸 は入出力電圧比となっている。また、表2には 10 個の BPF の遮断周波数や素子の計算結果を 示す。図9に示す波形から遮断周波数帯間の波 形がフラットになっていることがわかる。フラ ットにするためには Q 値をどのような値にす るかが重要であることが分かった。各 BPF の最 適なQ値に対して値が小さい時、中心周波数付 近の電圧の値が低くなる。逆に大きい時は中心 周波数付近の電圧の値が高くなる。表2に示し たQ値が最適化された値である。また、この計 算からR_fの値によって波形が左右に移動した り、狭帯域にならなくなる事から、理論値通り OR_f を使用する必要がある。しかし、 R_f の設定 には高い精度が必要で、固定抵抗と可変抵抗を 組み合わせた選定を行う。C_fは市販のものを選 んで使用する。



図 9. Mathematica による出力波形

表 2. 計算に使用した値(理論値)

	遮断周 波数 f [MHz]	Cf [F]	Rf [Ω]	R4 [Ω]	Q
BPF1	1.115	0. 01	14.27	28.36	70
	1.132	μ	14.06	27.93	
BPF2	2. 351	3300	20. 51	40.89	150
	2.368	р	20.37	40.6	150
BPF3	4. 598		34.61	69.1	200
	4.615	1000	34.49	68.85	300
BPF4	5.834	р	27.28	54.48	260
	5.851		27.2	54.32	300
BPF5	8. 081	470	41.9	83.72	480
	8.098	р	41.81	83.55	
BPF6	9.317	330	51.76	103. 44	500
	9. 334	р	51.67	103. 25	500
BPF7	11. 564		62.56	125. 03	720
	11. 581	220	62.47	124. 85	720
BPF8	12.800	р	56.52	112.96	740
	12. 817		56.44	112. 81	740
BPF9 -	15. 047	68. 75	153.85	307. 54	030
	15. 064	р	153. 68	307. 19	930
BPF10	16. 283	10	977.43	1953.87	000
	16.300	р	976.41	1951.84	330

8. まとめ

セパラトリクスの収縮率 15%の最適化(周 波数帯 0.675~0.68、CN 強度 2.4×10⁻⁵)を行 うことができた。また、最適化した帯域幅に対 応する 10 個の BPF の設計ができた。

文 献

- [1] 辻井博彦、遠藤真広、: コモンズ (2006)
- [2] T.Nakanishi, T.Furukawa, K.Yoshida, K.Noda, Nucl.Instr. and Meth.A553 (2005)400.